



令和6年1月19日 (R5-013)

地方独立行政法人 岩手県工業技術センター

一関高専の学生を対象とした半導体基礎セミナー 「フォトリソグラフィ入門」を開催します。

(地独)岩手県工業技術センター(理事長 戸舘 弘幸)では、いわて半導体関連産業集積促進協議会における人材育成活動の一環として、(公財)いわて産業振興センターからの委託を受け、一関工業高等専門学校の学生を対象とした半導体基礎セミナー「フォトリソグラフィ入門」を開催いたします。

世界的な半導体需要の高まりを受け、国内外で半導体関連企業の工場新設が相次ぎ、半導体関連技術者は今後ますます必要となることが予想されています。東北地域においても半導体関連企業の工場新設が相次いで発表されており、本県においても半導体関連技術者の育成が急務となっています。

そこで本セミナーでは、これから就職活動を行っていく学生に光センサの作製を題材として半導体デバイス製作技術のひとつである“フォトリソグラフィ※”を体験する機会を設け、初歩的な半導体デバイス作製技術の習得と業界への興味をもっていただくことを目標とします。

御多忙とは存じますが、是非当日の取材等よろしくお願い申し上げます。

セミナー名	半導体基礎セミナー「フォトリソグラフィ入門」
日時	令和6年1月23日(火) 9:30~16:30
会場	岩手県工業技術センター3階および先端科学技術研究センター1階クリーンルーム 〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡二丁目4番25号 TEL 019-635-1115
対象	一関工業高等専門学校 学生(6名)
参加費	無料
主催	地方独立行政法人岩手県工業技術センター
内容	・座学 フォトリソグラフィとは ・実習 マスクアライナとスパッタ装置による電極パターン形成 半導体特性評価装置による光センサ特性評価、等
問合せ先	(地独)岩手県工業技術センター 担当:機能材料技術部 須藤、遠藤 ホームページアドレス https://www2.pref.iwate.jp/~kiri/ TEL:019-635-1115 FAX:019-635-0311 E-mail:CD0002@pref.iwate.jp

※フォトリソグラフィとは・・・感光性の物質(フォトレジスト)を塗布したシリコン等の基板にマスクパターン(別紙 図1)を露光・現像することで、パターンを形成する技術。

フォトリソグラフィ用クリーンルーム (広さ：20m²、クリーン度：クラス 1,000)

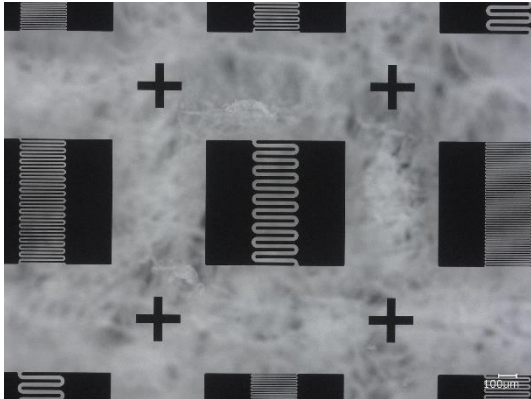


図1 マスクパターン



図2 スピンコータ

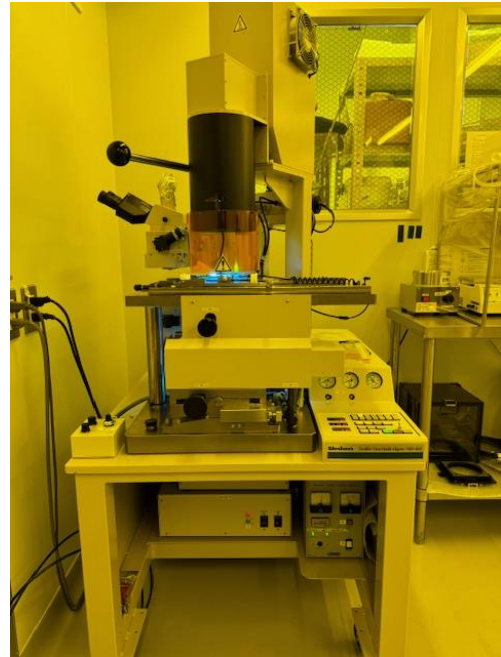


図3 マスクアライナ

成膜・加工用クリーンルーム (広さ：65m²、クリーン度：クラス 10,000)

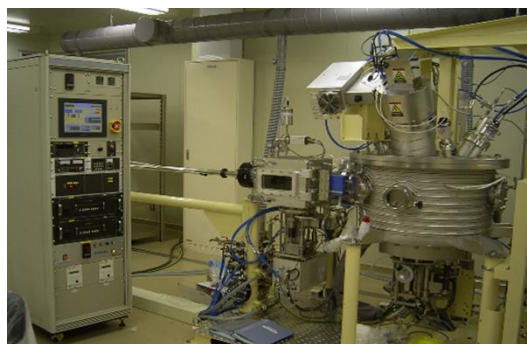


図4 三元同時スパッタ装置